

レーザーエリプソメーター

(ESM-1AT)

株式会社アルバック製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



エリプソメトリ（偏光解析）の原理を利用し、薄膜の膜厚と屈折率を高速でかつ高精度に測定することができる自動エリプソメータです。タッチパネル式の専用コントローラを採用していますので、簡単な操作で測定することができます。

装置の特長

薄膜の膜厚、屈折率を優れた再現性で測定

膜厚と同時に屈折率の測定

タッチパネル式の専用コントローラで、簡単な操作で測定

分布表示、多層膜解析、プサイ=デルタ線図などのオプションソフトも充実

半導体酸化膜、窒化膜、レジスト、ITOなどの膜厚、屈折率の測定

主な仕様

測定方式：偏光子調整型回転検光子変更解析

光源：He-Ne レーザー 波長：632.8nm 出力：0.8mW

入射角：55°、60°、65°、70°、75°

再現性〔1〕：膜厚 0.1nm 屈折率 0.001〔Si 基板上的 SiO₂（約 100nm）を 10 回繰り返し測定した場合の標準偏差〕

ステージサイズ：直径 170mm ステージ移動：R 125mm 自動、シータ 360°